

Anmeldung für eine Tagungsteilnahme

Bitte bis zum 14.11.2005 faxen an
(030) 63 92 – 65 01



Name _____

Vorname _____ Titel _____

Firma/Einrichtung _____

Adresse _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Spätanmeldung Poster ja nein

Titel des Posters (eine Kurzfassung des Beitrages mit Angabe der
Co-Autoren und der zugehörigen Firmen / Einrichtungen bitte beifügen)

Teilnahmegebühren

100,00 € bei Überweisung bis zum 31.10.2005,
150,00 € bei späterer Überweisung an:
IAP e.V. · Konto-Nr. 553 24 86 00 · Deutsche Bank AG Berlin · BLZ 100 700 00

Anmeldung von Ausstellungsfläche

4 m² 6 m² 8 m²

Miete 30,00 €/m² bei Überweisung bis zum 31.10.2005,
50,00 € bei späterer Überweisung.

Ein Vertreter des Ausstellers nimmt gebührenfrei an der Tagung teil.

Hotelreservierung

zu Vorzugspreisen von 55,00 € für ein EZ plus 9,00 € Frühstück

EZ DZ vom _____ bis _____

Ort, Datum

Unterschrift

Veranstalter

VDI/VDE – Gesellschaft Mess-
und Automatisierungstechnik (GMA);
VDI-Bezirksgruppe Berlin-Adlershof;
Optec Berlin-Brandenburg e.V.;
IAP Institut für angewandte
Photonik e.V., Berlin;
IfG – Institute for Scientific
Instruments GmbH, Berlin;
FhG-IZM (Fraunhofer Institut
Zuverlässigkeit und Mikro-
integration), Berlin;
TSB – Technologiestiftung, Berlin
Geschäftsstelle Adlershof;
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin;
Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt, Braunschweig und Berlin;
Technische Universität Berlin;
EXSA European X-Ray Spectrometry
Association

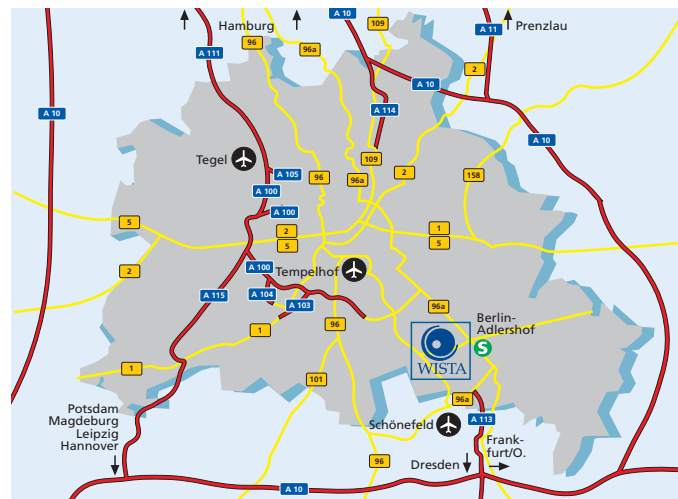
Programmkomitee

B. Beckhoff, PTB, Berlin;
A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin;
F. Burgäzy, Bruker AXS GmbH,
Karlsruhe;
W. Daum, BAM, Berlin;
B. Dollmann, STOE GmbH, Darmstadt;
J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG,
Duisburg;
M. Haschke, IfG GmbH, Berlin;

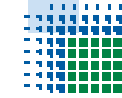
A. Janssen, FH Münster;
K. Janssens, Universität Antwerpen,
Belgien;
B. Kanngießer, TU Berlin;
B. Kämpfe, FhG-IZM, Berlin;
N. Langhoff, IfG GmbH, Berlin;
R. Meier, PANalytical B.V., Almelo,
Niederlande;
H. Miersch, SPECTRO GmbH & Co. KG,
Kleve;
U. Panne, BAM und HU Berlin;
W. Sandner, Max-Born-Institut Berlin;
G. Schneider, BESSY GmbH, Berlin;
Th. Schüle, Röntec AG, Berlin;
R. Wedell, IAP e.V., Berlin;
J. Wiesmann, Incoatec GmbH,
Geesthacht

Organisation und Korrespondenzanschrift

Dipl.-Ök. A. Weiß (Organisation)
Tel.: (030) 63 92 – 65 09
Fr. Ch. Menzel
(Sekretariat IAP e. V. und IfG GmbH)
Tel.: (030) 63 92 – 65 00
IAP Institut für angewandte
Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31
12489 Berlin
Fax: 6392-6501
E-Mail: info@ifg-adlershof.de



Anfahrtsskizzen auch unter www.wista.de



PRORA 2005

Programm

Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik

24. und 25. November 2005
am WISTA – Wissenschafts- und
Wirtschaftsstandort Berlin-Adlershof
Einstein-/Newton-Kabinett

Rudower Chaussee 17
12489 Berlin



DO 24. November

10.00 Uhr
Eröffnung N. Langhoff, W. Sandner

Neue Entwicklungen der Röntgenanalytik

10.15 – 12.15 Uhr
Leitung: N. Langhoff

10.15 Uhr
P. Hoffmann (TU Darmstadt)
RFA in der Prozesskontrolle: Einsatz und Beispiele

10.40 Uhr
U. Panne (BAM und HU Berlin)
Methodenkopplung in der Prozessanalytik

11.05 Uhr
J. Zieba-Palus (Institute of Forensic Research, Krakow)
Combination of Micro RAMAN and Micro XRF spectroscopy realised in the bench-top instrument PRAXIS – results of test measurements

11.30 Uhr
V. Rößiger (Helmut Fischer GmbH & Co. KG, Sindelfingen)
Über die Fähigkeit von RFA-Geräten zur Prozessüberwachung

11.45 Uhr
F. Eggert (IAP e. V., Berlin)
Die Kopplung der Aussagen von elektronen- und -röntgenangeregten Spektren von Proben in Rasterelektronenmikroskopen

12.00 – 13.00 Uhr Mittagspause

13.00 – 15.10 Uhr
Leitung: R. Wedell

13.00 Uhr
A. Erko (BESSY GmbH, Berlin)
Moderne Röntgenoptiken

13.20 Uhr
G. Schneider (BESSY GmbH, Berlin)
Anwendungen von Optiken in der Röntgenmikroskopie

13.40 Uhr
B. Kanngießer (TU Berlin)
Aufbau einer Strahlführung mit dedizierter Endstation für konfokale Mikro-RFA bei BESSY

14.00 Uhr
W. Malzer (TU Berlin)
Quantifizierungsmethoden für die konfokale μ -RFA

14.15 Uhr
M. Kolbe (PTB, Berlin)
Fundamentalparameter-gestützte Röntgenfluoreszenzanalyse im Vergleich zur Röntgenreflektometrie für Untersuchungen an ausgewählten Dünnschichtsystemen

14.30 Uhr
B. Beckhoff (PTB, Berlin)
Ultraspurenanalytik und -speziation auf Halbleiteroberflächen

14.50
H. Ebel (TU Wien)
Oberflächenanalytik mit der durch Röntgenstrahlung induzierten Gesamtelektronenemission

15.10 – 15.50 Kaffeepause

Methodische Besonderheiten der Prozessanalytik

15.50 – 17.40 Uhr
Leitung: U. Panne

15.50 Uhr
M. Mantler (TU Wien)
Neuere Entwicklungen bei der quantitativen RFA unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Prozessanalytik

16.15 Uhr
A. Janßen (FH Münster)/ J. Flock (ThyssenKrupp Stahl AG)
Probennahme und -präparation

16.40 Uhr
N. Langhoff (IfG GmbH, Berlin) u. a.
On-line XRF-Messungen zur Bestimmung des Zinkgehaltes von Konverterstaub bei Temperaturen im Bereich von 250 °C

16.55 Uhr
J. Wess (PANalytical B.V., Almelo)
XRF in der Prozesskontrolle

17.10 Uhr
R. König (APC GmbH, Eschborn)
On-line Analyse von Schüttgütern mit dem XRF-On-line Analysator SOLAS®

17.25 Uhr
A. Klein, A. Ritter (Indutech GmbH, Simmersfeld)/

K. Pilz (voestalpine Stahl GmbH, Linz)
On-line-Röntgenfluoreszenzmessungen an einer Koks-kohlemischung bei einer Förderrate von 300 t/h zur Analyse des Asche-, Schwefel- und Eisengehaltes sowie zur Berechnung der flüchtigen Bestandteile und der Schüttdichte

Postersession und Rundgang durch die Firmenausstellung

17.45 – 19.15 Uhr
Eröffnung: B. Beckhoff

W. Klöck (Röntgenanalytik Messtechnik GmbH, Taunusstein)
Applications of laboratory Micro-XRF

R. Terborg (RÖNTEC AG, Berlin)
Eine im Niederenergetischen erweiterte Atomdatenbank für die Elektronenstrahlmikroanalyse

M. Wilke (Univ. Potsdam), B. Beckhoff (PTB, Berlin) u. a.
RFA in Kombination mit NEXAFS-Analytik im Bereich weicher Röntgenstrahlung: Ein Beitrag zur Speziation von Eisen in Mineralien an den $L_{3,2}$ -Kanten

A. Kogelbauer (VA Erzberg GmbH, Eisenerz) A. Ritter und A. Klein (Indutech GmbH, Simmersfeld)
Untersuchungen zur Erkennung von Quecksilber in Eisenerz mittels K-Linien-Röntgenfluoreszenzmessungen

V.-D. Hodoroaba u. M. Procop (BAM, Berlin)
Simulation der Spektren von Röntgenröhren des Typs MCBM 50 im REM

M. Müller (PTB, Berlin) u. a.
Absolute Bestimmung der Wirkungsquerschnitte für resonante Raman-Streuung an Silizium unterhalb der K-Absorptionskante

A. Bjeoumikhov (IfG GmbH, Berlin)
Röntgendiffraktometrie in Rasterelektronenmikroskopen

A. Bjeoumikhov (IfG GmbH, Berlin) u. a.
Kapillaroptiken für Röntgenstrahlung und Neutronen

B. Beckhoff (PTB, Berlin) u. a.
Quantitative Untersuchung der Erhöhung der Fluoreszenzintensität leichter Elemente durch Photoelektronensekundanregungen

St. Braun (FhG IWS, Dresden) et al.
Multilayer monochromators for X-ray spectrometry

M. Wilke (Univ. Potsdam) et al.
XANES study on Fe, U & Th in hydrous melts at high pressure and temperature

A. Bayer (Laser Laboratorium Göttingen e. V.) et al.
Imaging and condensing optics for EUV radiation

Aussteller
amtec GmbH, Leipzig; Analyticon Instruments GmbH, Rosbach v. d. Höhe; Bruker AXS GmbH, Karlsruhe; IfG GmbH, Berlin; Incoatec GmbH, Geesthacht; KETEK GmbH, München; Osmic Inc., Auburn Hills; PANalytical B.V., Almelo; PNSensor GmbH, München; RÖNTEC AG, Berlin; Röntgenanalytik Messtechnik GmbH, Taunusstein; XENOCSS, Sassenage; AXO DRESDEN GmbH

19.15 Uhr Gemeinsames Abendessen

FR 25. November

Applikationen in Industrie und Forschung

8.30 – 10.35 Uhr
Leitung: R. Meier

8.30 Uhr
M. Paul (Dyckerhoff Zement GmbH, Wiesbaden)
Anwendung der Rietveld-Methode zur Prozess- und Qualitätskontrolle in der Zementindustrie

8.55 Uhr
B. Kämpfe (FhG-IZM, Berlin) u. a.
Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der energiedispersiven Röntgendiffraktometrie

9.20 Uhr
R. Arnhold (RÖNTEC AG, Berlin) u. a.
Anwendungen des Gerätes PolyTAX zur prozessnahen Element- und Strukturanalyse

9.35 Uhr
V. Kolarik (FhG – ICT, Pfinztal) u. a.
Anwendung der zweidimensionalen Röntgendiffraktometrie zur Charakterisierung der Werkstoffalterung in Industrieanlagen vor Ort

9.50 Uhr
M. Wolf (Wolf-Analytics, Analytik & Consulting, Fürth) / R. van Eldik (Universität Erlangen-Nürnberg)
Prüfung elektrotechnischer Produkte auf RoHS – Konformität mittels EDRFA

10.05 Uhr
A. Giannikos (Analyticon Instruments GmbH, Rosbach v. d. Höhe)
RoHS/WEEE-Glas-Coatings C-Stahl – Neueste Anwendungsmöglichkeiten für tragbare RFA

10.20 Uhr
A. Kharchenko (PANalytical B.V., Almelo)
Insitu-Echtzeit-Röntgenanalyse von MOCVD Wachstum

10.35 – 11.15 Uhr Kaffeepause

11.15 – 12.55 Uhr
Leitung: Th. Schülein

11.15 Uhr
Ch. W. Lehmann (MPI für Kohlenforschung, Mülheim)
High-Throughput Pulverdiffraktometrie für Polymorphiestudien an Pharmaka

11.40 Uhr
St. Schunk (hte Aktiengesellschaft, Heidelberg)
Application and Implementation of X-Ray Based Techniques in High Throughput Experimentation

11.55 Uhr
K. Stöwe (Universität des Saarlandes, Saarbrücken) u. a.
Kombinatorik und RFA

12.10 Uhr
O. Hahn (BAM, Berlin)
Kunst- und Kulturgutanalyse mittels Röntgenfluoreszenz

12.25 Uhr
I. Reiche (CRRMF Louvre, Paris) u. a.
Spurenanalytik an Silberstiftzeichnungen und archäologischen Goldobjekten mit Hilfe von Synchrotron-induzierter RFA

12.40 Uhr
A. Berendes (BKA Wiesbaden)
Untersuchung von Schmauchspuren mittels μ -RFA im Kriminaltechnischen Institut des Bundeskriminalamtes

12.55 – 14.10 Uhr Mittagspause

Neue Technologien und Geräte

14.10 – 16.30 Uhr
Leitung: M. Haschke

14.10 Uhr
J. Heckel (SPECTRO GmbH & Co. KG, Kleve)
Verwendung von Röntgenoptiken zur Verbesserung der analytischen Leistungsfähigkeit

14.25 Uhr
P. U. Pennartz (Osmic Inc., Auburn Hills) et al.
Multilayer Optic Based Components for X-Ray Equipment Used in Process Control

14.40 Uhr
J. Wiesmann (Incoatec GmbH, Geesthacht)
Multilayer-Optiken für moderne Röntgenanalytik

14.55 Uhr
F. Scholze (PTB, Berlin)
Kalibrierung von Röntgendetektoren und deren Einsatz in der Fundamentalparameter-gestützten RFA

15.15 Uhr
T. Eggert (KETEK GmbH, München)
u. a. Die spektrale Antwort von Silizium-Röntgendetektoren

15.30 Uhr
Th. Schülein (RÖNTEC AG, Berlin)
Silizium Drift Detektoren – neueste Entwicklungen

15.45 Uhr
O. Boslau (KETEK GmbH, München) u. a.

Arrays großflächiger Silizium-Drift-Detektoren für industrielle und medizinische Anwendungen

16.00 Uhr
F. Eggert (Röntgenanalytik Apparatebau GmbH, Berlin)
Einsatz eines flexiblen digitalen Signalprozessors für Röntgenspektrometrie

16.15 Uhr
H. Soltau (PNSensor GmbH, München) et al.
Large Area and optimized Read Out for SDDs with Integrated FET